

微波等离子CDV法在石英玻璃上生长金刚石薄膜

作者：朱建勇 梅炳初 李 力等 发表时间：2002-10-1 16:00:12

在真空条件下采用氢气刻蚀二氧化硅形成硅膜,用微波等离子化学气相沉积法在玻璃上生长金刚石薄膜,并用X射线衍射、Raman光谱和光电子能谱对石英玻璃上的金刚石薄膜进行分析,指出其形成中间层SiO₂/Si/SiC/C(金刚石)是在石英玻璃上生长金刚石薄膜的关键.



[加入收藏]



[打印本页]



[网上投稿]



[关闭返回]

版权所有：材料保护杂志社 中国表面工程信息网络中心 鄂ICP备05001264

Tel: 027-83330037 Fax: 027-83638752 E-mail: abc430030@126.com

短信平台：编辑“材料保护”发送到106650120留言（0.1元/条，接收免费）